PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

(43) Date of publication of application: 13.06.1985

(51)Int.CI.

G11B 5/31

(21)Application number: 58-215581

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

16.11.1983

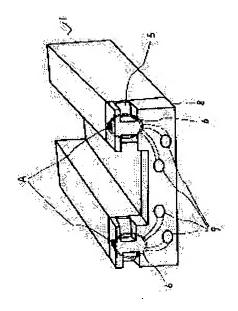
(72)Inventor: TANAKA HIDEO

(54) THIN FILM MAGNETIC HEAD

(57)Abstract:

PURPOSE: To eliminate the deterioration in recording and reproducing characteristic owing to the stress occurring in the thermal expansion of a resist layer and the damage and breakdown owing to a crash with respect to a thin film magnetic head for a magnetic disc device by removing the part on the transducer of an Al2O3 protective film layer and exposing the resist layer only in said part.

CONSTITUTION: An Al2O3 protective film layer 8 on the top side of a coil part is partly removed on both sides of a pole and a resist layer 5 is exposed. Then the force of the thermal expansion of the layer 5 by the heat generated in the coil 6 can be escaped to the part where the Al2O3 protective film is removed and the projection of the pole on the floating surface side A is eventually extremely decreased by which the deterioration in the characteristic owing to a crash and stress is prevented. The removal of the film 8 is accomplished by a method for masking the part except the part to be removed and performing ion milling.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭60 - 107715

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)6月13日

G 11 B 5/31

7426-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 薄膜磁気ヘッド

②特 願 昭58-215581

20出 願 昭58(1983)11月16日

砂発 明 者 田 中 英 男

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 内 原 晋

明細音

1. 発明の名称 薄膜磁気ヘッド

2. 特許請求の範囲

海膜磁気へッドにおいてコイル部分の上部の保 護膜層が一部分除去され、上部磁極の下のレジス ト層が露出していることを特徴とする海膜磁気へ ッド。

3. 発明の詳細な説明

本発明は磁気ディスク装置用導膜磁気へッドに かかる。

従来博膜磁気へッドのトランスデューサ部分に おいて、上部磁値と下部磁値の間には、コイルと それを収巻くレジストが存在する。磁気記録にお いて高密度化が進むにつれて、コイルの巻数を増 大させる必要がある。コイルの巻数が増大すると コイルの抵抗が増大し、その分配録時の発熱量が 多くなる。その結果、コイルの周りのレジストに 熱を与え、レジストは熱膨張を生じ、その熱膨張の力は上部磁値の機械的に弱い部分(段差部分)を押し出す力となる。押し出された上部磁値が薄膜磁気へッドスライダーの浮揚面より突起すると、薄膜磁気へッドのトランスデューサ部分は破を受け、薄膜で浮揚面におけるスライダーとトランスによった。特に浮揚面におけるスライダーとトランスによった。 サとの段差が小さいとき、レジストの熱彫張による時性の突起量が非常に小さい場合でも機械がある。からないまない場合でも機械の薄膜磁気へッドは有していた。

本発明の目的は、とれらの問題点を改善した源 膜磁気へッドを提供することにある。

本発明による溥膜磁気へっドは AL₂O₃ 保護膜層 のトランスデューサの上の部分を除去し、その部 分だけレジスト層を露出させ、コイルの発熱によ るレジスト層の熱膨張によって浮揚面側のボール 先端部分にかかる圧力を前記 AL₂O₃ 保護膜層を除 去した部分へ逃がす様にし、レジストの熱膨張に

時間昭60-107715 (2)

よるポールの突出を大幅に減少している。この様にすることにより、低スペーシング化を図り、高密度記録を行う場合でも、前記レジスト層の熱能張を起因とした時のストレスによる記録・再生特性の劣化やクラッシュによる損傷・破壊を除去することが可能となる。

以下本鉛明による薄膜磁気ヘッドを実施例により説明する。

奥施例

第1,2及び3図に本実施例の梅膜磁気ヘッド の構造を示す。

第1図はトランスデューサ部分の断面構造、第 2図はトランスデューサを上側から見た図であり、 第3図はさらに斜めから立体的に見た図である。

本実施例において 1 の Al₂O₃TiC 基板、 Al₂O₃ 層 2 . 下ポール 3 . ギャップ層 4 . レジスト層 5 上ポール 7 などは従来と全く同じ構造となっている。

しかしその上側の AL₂O₃ 保 膜層 8 の一部分が 第 3 図に示される様に、ボールの両側で除去され て、レジスト層 5 が鱒出していることを特徴としている。

この様にすることにより、コイル6の発熱によるレジスト層5の熱影張の力を、第3図のA420、保護膜除去部分へ逃がすことが出来、結果として 浮揚面側Aへのボールの突起が非常に少なくなり、 クラッシュヤストレスによる特性の劣化を防止することができる。

A4.0. 保機膜 8 の除去方法は、除去する部分以外をマスクし、イオンミリングで行なった。さらにあらかじめレジスト層 5 の上に、除去される部分をマスクして、A4.0. 保機膜 層 8 をスパッタ法により付与し、その後そのマスク部分を除去する方法も考えられる。

4. 図面の簡単な説明

第1図,第2図及び第3図はそれぞれ本実施例 の薄膜磁気へッドの断面図,平面図及び立体図で ある。

1 は A40 TIC 基板, 2 は A40 層, 3 は下ポー

ル・4 はギャッブ層(AL₂O₂)・5 はレジスト層・6 はコイル・7 は上ポール・8 は AL₂O₂ 保酸膜層・A は海旋磁気ヘッドの浮揚面・9 はコイル端子を示す。

第1図

第 2 図

化理人 介理上 内 原 音

